

## Oxford Instruments, Plasmalab 80 plus



### 功能/應用

Plasmalab 80 Plus 是一種等離子處理系統，配置為進行反應離子蝕刻。工藝配方包括蝕刻 SiOx，Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 和多晶矽。該系統非常適用於中試生產，快速原型設計，光電和微電子應用的開發。

### 規格

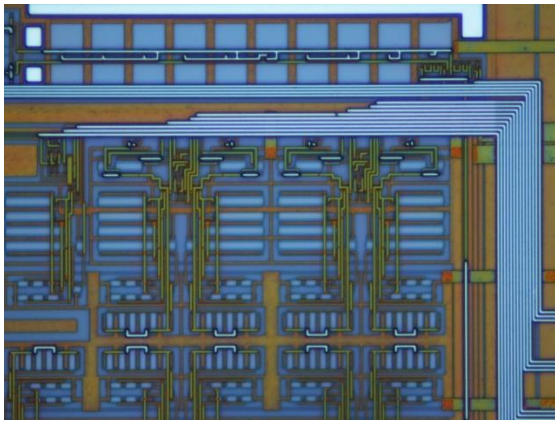
射頻功率範圍: 50-500 瓦

最大氣體流量: 100 sccm

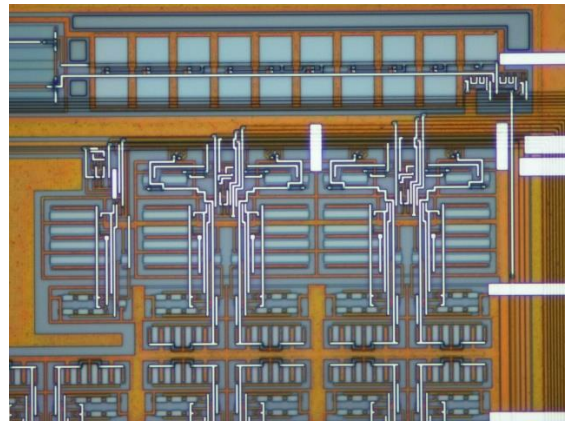
最大樣本尺寸: 8 寸晶圓

安裝氣體: 氧氣，氬氣，四氟化碳

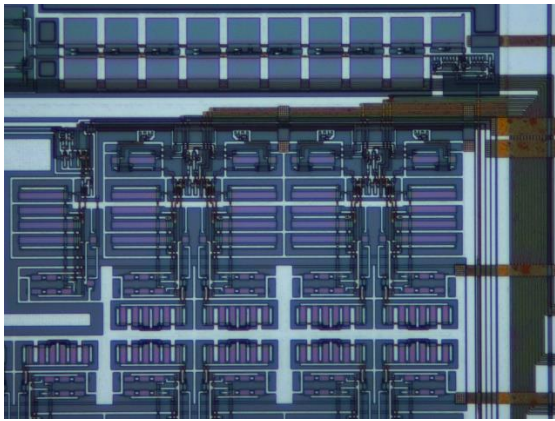
示例應用圖片



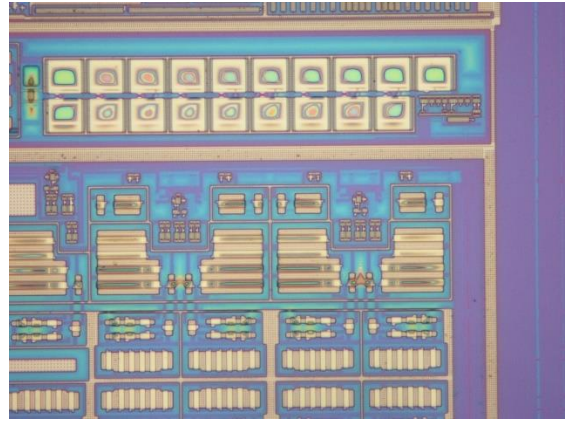
M3 金屬層



去除 M3 金屬層後



去除 M2 金屬層後



去除 M1 金屬層後

Youtube 演示視頻

[https://www.youtube.com/watch?v=u5oh\\_as9v28](https://www.youtube.com/watch?v=u5oh_as9v28)